PAT-NO: JP411053778A

DOCUMENT - IDENTIFIER: JP 11053778 A

PRODUCTION OF OPTICAL DISK DEVICE AND APPARATUS FOR

PRODUCING THE SAME

February 26, 1999

PUBN-DATE:

TITLE:

NAME

INVENTOR - INFORMATION:

NAKAJIMA, KAZUTO MATSUNAGA, KOJI

HIGAKI, NORIHIDE SOTOZONO, NOBUTAKA

ASSIGNEE - INFORMATION:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP09213019

APPL-DATE:

August 7, 1997

INT-CL (IPC): G11B007/26, B29D011/00 , B05C011/08

ABSTRACT:

for protective films by forming a UV curing type adhesive layer between two PROBLEM TO BE SOLVED: To rapidly cure an adhesive and to eliminate the need

irradiating this layer with UV rays. sheets of substrate such as DVD-RAM, having no light transmissibility and

thickness of about 50 μm. The adhesive 103 is thereafter irradiated for 10 seconds with the UV rays at illuminance of 500 mW/cm<SP>2</SP> by a UV therebetween and while the disk substrates 102 are rotated at a high speed, the adhesive 103 is discharged, by which the adhesive 10 is spread to the entire and the optical disk is formed. adhesive 103 is cured. part of the opposite surfaces between the disk substrates 102 to form a film and diameter of 120 mm are held at a prescribed spacing by disposing the substrates 102 from the flanks of the disk substrates 102, by which the irradiation device 110 in a direction parallel with the surfaces of the the acrylic resin adhesive 103 of a UV curing type is inserted into the spacing respective reflection films opposite to each other. A nozzle 109 for applying 15 mm in diameter in the central part of a disk having a thickness of 0.6 mm SOLUTION: Two sheets of the disk substrates 102 each formed with a hole of The disk substrates 102 are thus bonded to each other disk

COPYRIGHT: (C) 1999, JPO

## (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出廣公開番号

# 特開平11-53778

(43)公開日 平成11年(1999)2月26日

(51) Int.CL*		識別記号	ΡI		
G11B	7/26	531	G11B	7/26	531
B 2 9 D	11/00		B 2 9 D	11/00	
// B05C	11/08		B05C	11/08	

# 審査請求 未請求 請求項の数14 OL (全 9 頁)

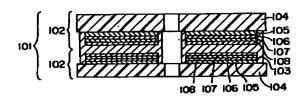
(21) 出顧番号	<b>特顧平9</b> -213019	(71)出職人 000005821		
		松下電器産業株式会社		
22)出顧日	平成9年(1997)8月7日	大阪府門真市大字門真1006番地		
		(72)発明者 松永 浩二		
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器		
		産業株式会社内		
		(72)発明者 中島 和人		
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器		
		<b>産業株式会社内</b>		
		(72)発明者 桧俎 典秀		
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器		
		產業株式会社内		
		(74)代理人 弁理士 青山 葆 (外2名)		
		最終質に絞く		

# (54) 【発明の名称】 光ディスク装置の製造方法およびその製造装置

# (57)【要約】

【課題】 光透過性の無いDVD-RAMのような基板を貼り合わせるのに、短時間で接着剤を硬化させることができ、しかも保護膜を必要としない光ディスク装置の製造方法及び装置を提供する。

【解決手段】 光ディスク装置の製造方法およびその製造装置は、基板104上に記録膜106が形成されたディスク基板102を2枚貼り合わせて形成する際に、2枚の基板間に紫外線硬化型の接着剤層103を形成する工程と、ディスク基板に対してディスク基板の表面に大略平行な方向から紫外線を接着剤層に照射する工程とを備える。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 透光性の基板(104)上に記録膜(1 06) が形成されたディスク基板 (102) を2枚貼り 合わせて形成する光ディスク装置の製造方法であって、 上記2枚のディスク基板間に紫外線硬化型の接着剤層 (103)を形成する工程と、

上記ディスク基板の表面に大略平行な方向から上記接着 剤層に紫外線を照射する工程とを備えることを特徴とす る光ディスク装置の製造方法。

【請求項2】 上記紫外線硬化型の接着剤の紫外線硬化 10 開始剤がフォスフィンオキサイドを含むようにした請求 項1に記載の光ディスク装置の製造方法。

【請求項3】 上記紫外線照射工程では、上記接着剤層 の外周側から上記紫外線が上記接着剤層に照射されるよ うにした請求項1又は2に記載の光ディスク装置の製造 方法。

【請求項4】 上記紫外線照射工程では、上記接着剤層 の内周側から上記紫外線が上記接着剤層に照射されるよ うにした請求項1~3のいずれかに記載の光ディスク装 置の製造方法。

【請求項5】 上記接着剤層形成工程では、上記2枚の ディスク基板を所定の間隔に保持し、その間隙に塗布ノ ズル (208)を挿入し、上記ディスク基板を回転させ ながら上記塗布ノズルから上記接着剤を吐出して上記間 隙に上記接着剤を供給する接着剤供給工程と、

上記接着剤を供給した後、上記ディスク基板を回転させ て上記接着剤を上記ディスク基板の対向する面全体に広 げるレベリング工程と、を備えるようにした請求項1~ 4のいずれかに記載の光ディスク装置の製造方法。

【請求項6】 上記接着剤層形成工程では、上記2枚の 30 ディスク基板のうちの一方のディスク基板の貼り合わせ 面に、所定の厚みの上記接着剤を塗布する工程と、

上記接着剤が塗布された上記一方のディスク基板を上記 2枚のディスク基板のうちの他方のディスク基板に向か い合わせて、加圧して貼り合わせる工程と、を備えるよ うにした請求項1~4のいずれかに記載の光ディスク装 置の製造方法。

【請求項7】 上記接着剤層形成工程では、上記2枚の ディスク基板のうちの一方のディスク基板の貼り合わせ 面に、所定の厚みの上記接着剤をスクリーン印刷により 40 形成する工程と、

上記接着剤が塗布された上記一方のディスク基板を上記 2枚のディスク基板のうちの他方のディスク基板に向か い合わせて、加圧して貼り合わせる工程と、を備えるよ うにした請求項1~4のいずれかに記載の光ディスク装 置の製造方法。

【請求項8】 2枚のディスク基板(102,204, 206)を貼り合わせる装置であって、

上記2枚のディスク基板間に紫外線硬化型の接着剤層

9, 208, 251, 150, 151, 152)と、 上記接着剤層が形成された上記ディスク基板の表面に大 略平行な方向に紫外線を上記接着剤層に照射する紫外線 照射装置(110、218、211、212、215、 216, 156) とを備えることを特徴とする光ディス ク装置の製造装置。

2

【請求項9】 上記紫外線硬化型の接着剤の紫外線硬化 開始剤がフォスフィンオキサイドを含むようにした請求 項8に記載の光ディスク装置の製造装置。

【請求項10】 上記紫外線照射装置(110、21 8,211,216,156)は、上記接着剤層の外周 側に配置され、上記接着剤層の外周側から上記紫外線を 上記接着剤層に照射するようにした請求項8又は9に記 載の光ディスク装置の製造装置。

【請求項11】 上記紫外線照射装置(212,21 5)は、上記接着剤層の内周側に配置され、上記接着剤 層の内周側から上記紫外線を上記接着剤層に照射するよ うにした請求項8~10のいずれかに記載の光ディスク 装置の製造装置。

- 20 【請求項12】 上記接着剤層形成装置が、上記2枚の ディスク基板を所定の間隔に保持し、その間隙に塗布ノ ズル(109,208)を挿入し、上記ディスク基板を 回転させながら上記塗布ノズルから上記接着剤を吐出し て上記間隙に上記接着剤を供給する接着剤供給装置(2 02)と、上記接着剤を供給した後、上記ディスク基板 を回転させて上記接着剤を上記ディスク基板の対向する 面全体に広げるレベリング装置(203)と、を備える ようにした請求項8~11のいずれかに記載の光ディス ク装置の製造装置。
- 【請求項13】 上記接着剤層形成装置が、上記2枚の ディスク基板のうちの一方のディスク基板の貼り合わせ 面に、所定の厚みの上記接着剤を塗布する装置と、 上記接着剤が塗布された上記一方のディスク基板を上記 2枚のディスク基板のうちの他方のディスク基板に向か い合わせて、加圧して貼り合わせる装置と、を備えるよ うにした請求項8~11のいずれかに記載の光ディスク 装置の製造装置。

【請求項14】 上記接着剤層形成装置は、上記2枚の ディスク基板のうちの一方のディスク基板の貼り合わせ 面に、所定の厚みの上記接着剤をスクリーン印刷により 形成する装置(150, 151, 152)と、

上記接着剤が塗布された上記一方のディスク基板を、上 記2枚のディスク基板のうちの他方のディスク基板に向 かい合わせて、加圧して貼り合わせる装置(153,1 54, 155)と、を備えるようにした請求項8~11 のいずれかに記載の光ディスク装置の製造装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光ディスク装置の (103,240)を形成する接着剤層形成装置(10-50 製造方法および製造装置に関するものであり、さらに詳 3

しくは、ディスク基板の貼り合わせ及び基板貼り合わせ 装置に関するものである。

### [0002]

【従来の技術】近年の情報化社会において、大容量の記 録メディアが注目されており、PD (相変化光ディス ク: Phase change optical Disk)、MOディスク(光 磁気ディスク: Magneto-Optical Disk) など数100M Bの記録容量をメディアが実用化されている。しかしな がら、画像圧縮の技術なども進歩し、数GB以上のメデ ィアが要望されている。ROM (読み出し専用) につい 10 ては、DVD (ディジタルビデオディスク) が実用化さ れ最大9GBもの大容量を実現している。一方、RAM (読み書き両用) については、前述のPDやMOの60 OMB程度が最大であり、さらなる大容量化を目指し て、DVD-RAMの開発が注目されている。DVD は、0.6mm厚みの樹脂基板を2枚貼り合わせて、1 枚のディスクを構成している。 DVD-ROMの場合 は、情報のピットが形成された樹脂基板に読み取り用の レーザーを反射する反射膜が形成された構造になってお り、2枚の樹脂基板の内どちらか1枚に光透過性がある 20 ため、2枚の基板の貼り合わせに用いる接着剤の硬化方 法に紫外線硬化法を用いることができる。

【0003】図8にその製造方法の概略図を示す。情報 ディスク基板301は、厚さ0.6mmで、直径約12 Omm、中心部に直径約15mmの孔が形成されたドー ナッツ状の形状で、その表面に記録情報のピットが形成 されている。貼り合せディスク基板302は情報が記録 されていない基板である。 図8 (a) に示すように、 情 報ディスク基板301を回転ベース300の上に載置し より接着剤304を情報ディスク基板301を回転ベー ス300で回転させながらドーナッツ状に塗布する。次 いで、図8 (b) に示すように、貼り合わせディスク基 板302を上記情報ディスク基板301の上に重ね合わ せ、高速回転(約3000 rpm)にて接着剤304を 2つのディスク基板301、302の対向する2つの面 全体に広げ、膜厚が50µm程度になるまで回転ベース 300により回転させる。その後、図8(c)に示すよ うに、光透過性のある、貼り合わせディスク基板302 の上面から、紫外線を約500mW/cm2の照度で1 0秒間照射して接着剤304を硬化させる。ところが、 DVD-RAMの場合は、2つの樹脂基板にそれぞれ記 録膜が形成されているため、両方の基板とも光透過性が 無い。そのため、一方の樹脂基板を透過して紫外線を2 つの樹脂基板間の接着剤に照射して硬化させることがで きず、紫外線硬化型の接着剤が用いることができない。 よって、紫外線硬化型の接着剤の代わりに、2液反応 型、嫌気反応型、若しくは遅効反応型の接着剤や、接着 テープなどが検討されている。

【0004】2液反応型の接着剤の場合:2枚の基板の 50 提供する。本発明の第4態様によれば、上記紫外線照射

それぞれに、2液のA剤、B剤を塗布した後、貼り合わせ、反応硬化させる。反応硬化のため、硬化時間がかかり、また、2液の接触が不完全な場合、反応が起こらず、未反応で残る場合がある。

4

嫌気反応型の接着剤の場合:空気を遮断することで、反 応が進行するが、反応速度が遅く、接着剤自身が腐食性 を持っているため、ディスクの記録膜や反射膜にダメー ジを与えることになり、保護膜が必要となる。

遅効反応型の接着剤の場合:エボキシのカチオン型の樹脂が用いられることが多く、片方の基板に接着剤を塗布した後、紫外線を照射し活性化処理を行う。その後、2枚の基板を貼り合わせると、反応硬化が起こる。この場合、反応時間が長く、また、嫌気反応型と同様に腐食性があるため、保護膜が必要である。

接着テープの場合:ベースフィルムに熱可塑性の樹脂を 粘着剤として塗布し、その上面に保護フィルムを貼る。 工程としては、保護フィルムを剥がし、片方のディスク に貼りつけた後、ベースフィルムを剥がし、もう片方の ディスクを貼り付ける。熱可塑性の樹脂が粘着剤になっ ているため、耐熱性に乏しく、ベースフィルムや保護フィルムなど間接部材が多く、コスト的に不利である。ま た、貼り合わせ時に、気泡を抱き込みやすく、腐食の原 因となる。

### [0005]

0mm、中心部に直径約15mmの孔が形成されたドーナッツ状の形状で、その表面に記録情報のピットが形成されている。貼り合せディスク基板302は情報が記録されているが、いずれも、①硬化に時間がかかる、②接着されていない基板である。図8(a)に示すように、情報ディスク基板301を回転ベース300の上に載置したのち、情報ディスク基板301に塗布ノズル303に30より接着剤304を情報ディスク基板301を回転ベース300で回転させながらドーナッツ状に塗布する。次いで、図8(b)に示すように、貼り合わせディスク基 ことである。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】本発明は上記目的を達成するため、以下のように構成している。本発明の第1態様によれば、透光性の基板上に記録膜が形成されたディスク基板を2枚貼り合わせて形成する光ディスク装置の製造方法であって、上記2枚のディスク基板間に紫外線の表面に大略平行な方向から上記接着剤層に紫外線を照射する工程とを備えることを特徴とする光ディスク装置の製造方法を提供する。本発明の第2態様によれば、上記紫外線硬化型の接着剤の紫外線硬化開始剤がフォスフィンオキサイドを含むようにした第1態様に記載の光ディスク装置の製造方法を提供する。本発明の第3態様によれば、上記紫外線照射工程では、上記接着剤層の外周関から上記紫外線が上記接着剤層に照射されるようにした第1又は2態様に記載の光ディスク装置の製造方法を50提供する。本発明の第4節様によれば、上記紫外線が

工程では、上記接着剤層の内周側から上記紫外線が上記接着剤層に照射されるようにした第1~3態様のいずれかに記載の光ディスク装置の製造方法を提供する。本発明の第5態様によれば、上記接着剤層形成工程では、上記2枚のディスク基板を所定の間隔に保持し、その間隙に塗布ノズルを挿入し、上記ディスク基板を回転させながら上記塗布ノズルから上記接着剤を吐出して上記間隙に上記接着剤を供給する接着剤供給工程と、上記接着剤を供給した後、上記ディスク基板を回転させて上記接着剤を上記ディスク基板の対向する面全体に広げるレベリング工程と、を備えるようにした第1~4態様のいずれかに記載の光ディスク装置の製造方法を提供する。

【0007】本発明の第6態様によれば、上記接着剤層 形成工程では、上記2枚のディスク基板のうちの一方の ディスク基板の貼り合わせ面に、所定の厚みの上記接着 剤を塗布する工程と、上記接着剤が塗布された上記一方 のディスク基板を上記2枚のディスク基板のうちの他方 のディスク基板に向かい合わせて、加圧して貼り合わせ る工程と、を備えるようにした第1~4 態様のいずれか に記載の光ディスク装置の製造方法を提供する。本発明 20 の第7態様によれば、上記接着剤層形成工程では、上記 2枚のディスク基板のうちの一方のディスク基板の貼り 合わせ面に、所定の厚みの上記接着剤をスクリーン印刷 により形成する工程と、上記接着剤が塗布された上記一 方のディスク基板を上記2枚のディスク基板のうちの他 方のディスク基板に向かい合わせて、加圧して貼り合わ せる工程と、を備えるようにした第1~4態様のいずれ かに記載の光ディスク装置の製造方法を提供する。

【0008】本発明の第8態様によれば、2枚のディス ク基板を貼り合わせる装置であって、上記2枚のディス ク基板間に紫外線硬化型の接着剤層を形成する接着剤層 形成装置と、上記接着剤層が形成された上記ディスク基 板の表面に大略平行な方向に紫外線を上記接着剤層に照 射する紫外線照射装置とを備えることを特徴とする光デ ィスク装置の製造装置を提供する。本発明の第9個様に よれば、上記紫外線硬化型の接着剤の紫外線硬化開始剤 がフォスフィンオキサイドを含むようにした第8態様に 記載の光ディスク装置の製造装置を提供する。本発明の 第10態様によれば、上記紫外線照射装置は、上記接着 剤層の外周側に配置され、上記接着剤層の外周側から上 40 記集外線を上記接着剤層に照射するようにした第8又は 9態様に記載の光ディスク装置の製造装置を提供する。 本発明の第11態様によれば、上記紫外線照射装置は、 上記接着剤層の内周側に配置され、上記接着剤層の内周 側から上記紫外線を上記接着剤層に照射するようにした 第8~10態様のいずれかに記載の光ディスク装置の製 造装置を提供する。

【0009】本発明の第12態様によれば、上記接着剤 層形成装置が、上記2枚のディスク基板を所定の間隔に 保持し、その間隙に塗布ノズルを挿入し、上記ディスク

基板を回転させながら上記塗布ノズルから上記接着剤を 吐出して上記間隙に上記接着剤を供給する接着剤供給装 置と、上記接着剤を供給した後、上記ディスク基板を回 転させて上記接着剤を上記ディスク基板の対向する面全 体に広げるレベリング装置と、を備えるようにした第8 ~11態様のいずれかに記載の光ディスク装置の製造装 置を提供する。本発明の第13態様によれば、上記接着 剤層形成装置が、上記2枚のディスク基板のうちの一方 のディスク基板の貼り合わせ面に、所定の厚みの上記接 着剤を塗布する装置と、上記接着剤が塗布された上記一 方のディスク基板を上記2枚のディスク基板のうちの他 方のディスク基板に向かい合わせて、加圧して貼り合わ せる装置と、を備えるようにした第8~11態様のいず れかに記載の光ディスク装置の製造装置を提供する。本 発明の第14態様によれば、上記接着剤層形成装置は、 上記2枚のディスク基板のうちの一方のディスク基板の 貼り合わせ面に、所定の厚みの上記接着剤をスクリーン 印刷により形成する装置と、上記接着剤が塗布された上 記一方のディスク基板を、上記2枚のディスク基板のう ちの他方のディスク基板に向かい合わせて、加圧して貼 り合わせる装置と、を備えるようにした第8~11競技 のいずれかに記載の光ディスク装置の製造装置を提供す

6

[0010]

【発明の実施の形態】図1に、本発明の第1実施形態にかかる光ディスク装置の断面構造を示す。図2(a)~(d)に上記光ディスク装置の製造工程を、図3

(a), (b)にその製造装置の機略図を示す。図1において、本発明の第1実施形態にかかる光ディスク装置101は、ディスク基板102を2枚向かい合わせに接着剤103を用いて貼り合わせた構造になっている。各ディスク基板102は、透光性樹脂基板104上に誘電体膜105、記録膜106、誘電体膜107、反射膜108の順に積層されて構成されている。ここで、一例として、透光性樹脂基板104としてボリカーボネート、誘電体膜105、107としてZnS-SiO2、記録膜106としてGeSbTe、反射膜108としてAl-2%Siを用いることができる。

【0011】図2(a)~(d)を用いて、上記光ディ 40 スク装置の製造方法を説明する。各ディスク基板102 は、一例として、厚さ0.6mmで、直径約120m m、中心部に直径約15mmの孔が形成されたドーナッ ツ状の形状である。図2(a)に示すように、この2枚 のディスク基板102,102を反射膜108,108 を向かい合わせて、所定の間隔に設置する。次いで、図 2(b)に示すように、その間隙に、接着剤103を塗 布するノズル109を挿入し、ディスク基板102,1 02を回転させながら、接着剤103を吐出する。次い で、図2(c)に示すように、接着剤103は、一例と 50 して、紫外線硬化型のアクリル樹脂で、紫外線硬化開始 剤が分子構造中にフォスフィンオキサイド (>P=O 基) を有するものであり、例えば、ピス(2、6ージメ チルオキシベンゾイル)-2,4,4-トリメチルーペ ンチルフォスフィンオキサイドを50重量%含むチバガ イキー社製のイルガキュア(登録商標)1850であっ て、この紫外線硬化開始剤を2重量%含んでいるものを 用いることができる。その他の例としては、ビス(2、 4,6-トリメチルベンゾイル)-フェニルフォスフィ ンオキサイドも使用可能である。その後、図2(c)に 示すように、高速回転 (例えば3000rpm) にて接 10 着剤103を2つの基板102,102の対向する2つ の面の全体に広げ、接着剤103の層の膜厚が50 μm 程度になるまで回転させる。その後、図2(d)に示す ように、ディスク基板102、102の側面から、ディ スク基板102の表面に大略平行な方向に、紫外線照射 機110 (後記するようにリング状又は棒状のでもよ く、その他の形状でもよい。) により紫外線を接着剤1 03に対して約500mW/cm2の照度で10秒間照 射して、接着剤103を硬化させる。

【0012】図3 (a), (b)は上記第1実施形態で 20 用いた製造装置の機略図を示す。図3(a)において、 201は接着剤層形成ステージ(接着剤層形成装置) で、接着剤供給ステージ (接着剤供給装置) 202とレ ベリングステージ (レベリング装置) 203とを備えて いる。図3(a)の左側の接着剤供給ステージ202 は、図1の下側のディスク基板102に対応する下基板 204を設置する回転ベース205と、モータ等から構 成されて回転ベース205を軸方向に進退駆動しかつ回 転駆動する下側駆動装置255と、図1の上側のディス ース207と、モータ等から構成されて回転ベース20 7を軸方向に進退駆動しかつ下側駆動装置257と同期 して回転ベース207を回転駆動する上側駆動装置25 7と、接着剤240を供給する塗布ノズル208と、塗 布ノズル208を基板204,206間に対して進退さ せるとともに塗布ノズル先端から接着剤240を塗布さ せる塗布ノズル駆動装置251と、2つのモータ25 5,257の駆動と塗布ノズル駆動装置251の駆動を 制御する制御装置250とを備えている。回転ベース2 05と保持ペース207に上下基板206,204を設 40 置した後、制御装置250の制御の下に上側及び下側駆 動装置257,255又は上側駆動装置257若しくは 下側駆動装置255のいずれかの駆動により、上下基板 206,204間を所定の間隔に保持する。制御装置2 50の制御の下に塗布ノズル駆動装置251の駆動によ り、塗布ノズル208の先端を上下基板204,206 間に挿入し、上下基板206,204を下側駆動装置2 55及び上側駆動装置257の同期駆動により回転ベー ス205,207とともに基板204,206を一体的 に同一方向に同一速度で回転させながら塗布ノズル20 50 ち、内周側からの紫外線照射は、図4(c)に示すよう

8の先端から接着剤240を吐出させ、ドーナッツ状に 上下基板206.204の対向する面間に塗布する。こ の工程若しくは次の工程の開始前には、2つの基板を接 近させて接着剤層をある程度の厚さまで押圧させること により、レベリング後の膜厚の均一性の向上、レベリン グ時間の短縮に寄与することができる。

8

【0013】図3 (a)の右側のレベリングステージ2 03では、接着剤供給ステージ202にて接着剤が塗布 された2つの基板206、204をレベリングステージ 203に設置した後、モータ等の回転駆動装置259に より回転ベース242とともに基板206,204を所 定の回転数で回転させ、過剰の接着剤240を遠心力で 振り切りながら、接着剤240が所定の厚みになるまで 基板206,204を回転させることができる。レベリ ングステージ203でレベリングする前に、接着剤供給 ステージ202又はレベリングステージ203で、上下 基板204,206を接近させて接着剤層を所定厚みま で押圧することにより、レベリング後の膜厚の均一性の 向上、レベリング時間の短縮に寄与することができる。 図3 (b) において、209は紫外線照射ステージ (紫 外線照射装置)で、接着剤240が層状に形成された上 下基板206,204を設置する紫外線照射ベース21 0と、紫外線照射ペース210を回転させる回転駆動装 置260と、紫外線照射機218とを備えている。上下 基板206,204間の接着剤240の層に対し、紫外 線照射機218は外周側から中心部に向けての一方向 (例えば基板の径方向)でかつ基板206又は204の 表面に大略平行な方向から紫外線が照射できるようにな っており、回転駆動装置260の駆動により紫外線照射 ク基板102に対応する上基板206を保持する保持べ 30 ベース210が回転することにより、基板全周にわたっ て均一に紫外線を照射することができる。 なお、 紫外線 を照射する方向の条件、言い換えれば紫外線の照射角度 としては、基板204,206の対向する面に平行であ ることが好ましく、これ以外の方向では、紫外線が基板 間に入りにくくなり、紫外線の有効利用の観点から好ま しくない。紫外線の照射は径方向外側から内向きに又は 内側から外向きに行ってもよい。

【0014】図4(a), (b)は本発明の第2実施形 態にかかる光ディスク装置の製造装置の紫外線照射ステ ージ209を示したもので、紫外線照射機211が円環 状に形成されており、ディスク基板204,206の外 周全体に紫外線を、ディスク基板204,206の各表 面に大略平行な方向から、照射できる構造になってお り、紫外線照射ベース210は回転しなくても良い。ま た、図4 (c)に示すように、本発明の第3実施形態に かかる光ディスク装置の製造装置の紫外線照射ステージ 209においては、第1又は2実施形態の上記製造装置 に加えて、紫外線が基板204,206の外周側のみで なく内周側からも照射できる構造になっている。すなわ に、基板204,206の中心部の上方に紫外線照射機 212を配置し、この紫外線照射機212からの紫外線 の光を、基板204,206を集外線照射ベース210 に位置決めして支持するセンターピン213の先端の円 錐面231aに照射させて反射させて、基板204,2 06間の接着剤240に内周側からも紫外線を照射でき るようにしても良い。この内周囲から紫外線を照射する とき、ディスク基板204、206の表面に大略平行な 方向とすれば、内周側と外周側の中間部分の接着剤24 Oまで照射可能となり、好ましい。また、図4 (d)に 示すように、本発明の第4実施形態にかかる光ディスク 装置の製造装置の紫外線照射ステージ209において は、第3実施形態に代えて、センターピン214を紫外 線を透過する材質で作り、装置下部に配置した紫外線照 射機215からセンターピン214の内部に紫外線を導 いて、センターピン214の先端において、先端の中央 部の断面V字状にくばんだ円錐面214aで径方向外向 きに反射して、紫外線が基板204,206間の接着剤 204に基板内周側から紫外線を照射するようにしても 良い。

【0015】さらに、図5に示すように、本発明の第5 実施形態にかかる光ディスク装置の製造装置の紫外線照 射ステージ209においては、第1,2実施形態に代え て、基板204,206の外周の相対向する2カ所に、 細長い紫外線照射機216,216が配置されて、一対 の紫外線照射機216,216が配置されて、一対 の紫外線照射機216,216から細長いベルト状の紫 外線を基板204,206の外周に向けて照射できるよ うになっており、駆動装置217の駆動により紫外線照 射ベース210は回転しながら一対の紫外線照射機21 6,216の間を相対的に通過するような構造になって30 いる。

【0016】図6は、接着剤240の一実施例として、 ピス(2,6-ジメチルオキシベンゾイル)-2,4, 4ートリメチルーペンチルフォスフィンオキサイド50 重量%を含むチバガイキー社製のイルガキュア (登録商 標)1850を使用するとき、その接着剤中の含有量と 硬化深度の関係を示したものである。 含有量が、2重量 %のときに最も硬化深度が大きくなり、それ以上では反 応開始剤自身の紫外線吸収により深部まで紫外線が到達 しないため、硬化深度が浅くなる。本実施例で用いたデ ィスク基板は直径で約120mmであるが、記録領域が 外周から半径方向で約50mmの基板であり、この約5 0mmを硬化する必要があるため、2重量%のものを用 いた。しかしながら、MD(ミニディク)で用いられる ような小さな径の基板であれば2重量%である必要はな く、硬化時間との関係で最適値を選択すればよい。この ようにして、成形した光ディスク装置の信頼性評価を8 0℃85%×96時間の条件(DVDにおける高温高温 試験の標準試験条件)で行ったが、チルト特性および記 録再生特性ともに問題の発生は無かった。

10 【0017】図7 (a)~(c)に、本発明の第6実施 形態にかかる光ディスク装置の製造工程を示す。ディス ク基板101は、前述の第1実施形態で用いたものと同 じものを用いる。 図7 (a)に示すように、 2枚のディ スク基板102,102のうちの一方のディスク基板1 02の反射膜108上に接着剤103をスクリーン印刷 により約30μmの厚みに塗布して接着剤103の層を 反射膜108上に形成する。 図7(a) において、 15 0はスクリーン、151はスキージ、152はディスク 基板102を載置する載置台であり、スクリーン150 上の接着剤103をスキージ151により移動させて、 ディスク基板102の接着剤103を塗布すべき箇所に のみスクリーン150を通して接着剤103を通過させ てスクリーン印刷するものである。接着剤103は、-例として、紫外線硬化型のアクリル樹脂で、紫外線硬化 開始剤が分子構造中にフォスフィンオキサイド(>P= O基) を有するものであり、例えば、ビス(2,6-ジ メチルオキシベンゾイル) -2, 4, 4-トリメチルー ペンチルフォスフィンオキサイドを50重量%含むチバ 20 ガイキー社製のイルガキュア (登録商標) 1850であ って、この紫外線硬化開始剤を2重量%含んでいるもの を用いることができる。 図7 (b) に示すように、2枚 のディスク基板102,102を向かい合わせるように 押圧ベース153と回転ベース154にそれぞれディス ク基板102,102を支持し、かつ、回転ベース15 4に対してモータ又はエアシリンダ等の駆動装置155 により押圧ベース153を下降させて、厚みが50μm になるように接着剤103の層をプレスする。その後、 図7 (c) に示すように、回転ベース154をモータ等 の回転駆動装置157で回転させてディスク基板10 2, 102と接着剤103を回転させながら、ディスク 基板102,102の外側面から、紫外線照射機156 により紫外線を約500mW/cm2の照度で10秒間 接着剤103に照射して接着剤13を硬化させる。な お、本発明は、上記実施形態に限定されるものではな く、その他種々の態様で実施することができる。

【発明の効果】本発明に係わる光ディスク装置の製造方法及び装置では、紫外線硬化型の接着剤、例えば長波長40 域に吸収を持つ紫外線吸収剤を含有する接着剤、を用いてディスク基板の表面に大略平行な方向から紫外線を照射することにより、ディスク基板間に形成された接着剤を硬化させることができる。これにより、従来は、ディスク基板の光透過性などの基板の特性により貼り合わせ工法を選択していたが、本発明の製造方法及び装置では、全てのディスク基板に同一の装置又は方法で対応することができる。言い換えれば、光透過性の有無にかかわらず、ディスク基板の表面に大略平行な方向から紫外線を接着剤層に照射すればよく、総てのディスク基板に50 対して対応することができる。しかも、反応硬化型の接

[0018]

12

着剤と異なり、紫外線硬化型の接着剤であるため、反応 時間も数秒と短く、基板に対する腐食性もないので保護 コートの必要性もない。また、接着剤層に対して、ディ スク基板の外周側と内周側の両方から紫外線を照射する 場合には、いずれか一方から紫外線を照射する場合と比 較して、より効率良く、接着剤層を紫外線硬化させるこ とができる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1実施形態にかかる光ディスク装 置の断面構造図である。

【図2】 (a), (b), (c), (d) はそれぞれ 本発明の第1実施形態にかかる光ディスク装置の製造工 程を説明する一部断面側面図である。

【図3】 (a), (b) はそれぞれ本発明の第1実施 形態にかかる光ディスク装置の製造装置の各ステージで の機略一部断面側面図である。

【図4】 (a), (b) はそれぞれ本発明の第2実施 形態にかかる光ディスク装置の製造装置の紫外線照射ス テージの紫外線照射機の平面図及び一部断面側面図、

(c) は本発明の第3実施形態にかかる光ディスク装置 20 205 回転ベース の製造装置の紫外線照射ステージの紫外線照射機の一部 断面側面図、(d)は本発明の第4実施形態にかかる光 ディスク装置の製造装置の紫外線照射ステージの紫外線 照射機の一部断面側面図である。

【図5】 本発明の第5実施形態にかかる光ディスク装 置の製造装置の紫外線照射ステージの紫外線照射機の斜 視図である。

【図6】 本発明の上記実施形態にかかる光ディスク装 置において接着剤の例として使用する光重合開始剤の特 性を示す図である。

【図7】 (a), (b), (c)はそれぞれ本発明の 第6実施形態にかかる光ディスク装置の製造工程を説明 する一部断面側面図である。

【図8】 (a), (b), (c) はそれぞれ従来の技 術の光ディスク装置の製造工程を説明する一部断面側面

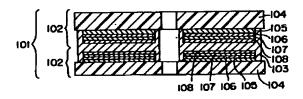
図である。

【符号の説明】

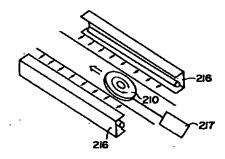
- 101 光ディスク装置
- 102 ディスク基板
- 103 接着剤
- 104 透光性樹脂基板
- 105 誘電体膜
- 106 記錄膜
- 107 誘電体膜
- 108 反射膜
- 109 ノズル

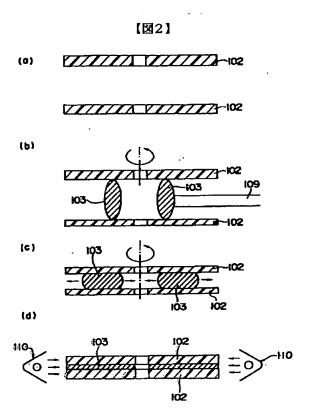
  - 110 紫外線照射機
  - 150 スクリーン
  - 151 スキージ
  - 152 載置台
  - 201 接着剤層形成ステージ
  - 202 接着剤供給ステージ
  - 203 レベリングステージ
  - 204 下基板
- - 206 上基板
  - 207 保持ベース
  - 208 塗布ノズル
  - 209 紫外線照射ステージ
  - 210 紫外線照射ベース
  - 211, 212, 215, 216, 218 紫外線照射
  - 213, 214 センターピン
  - 217 駆動装置
- 30 240 接着剤
  - 250 制御装置
  - 251 塗布ノズル駆動装置
  - 255 下側駆動装置
  - 257 上側駆動装置
  - 260 回転駆動装置

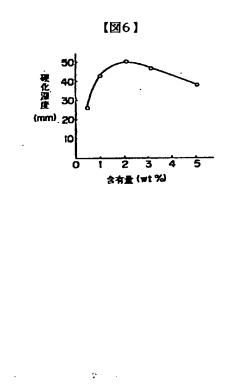
【図1】

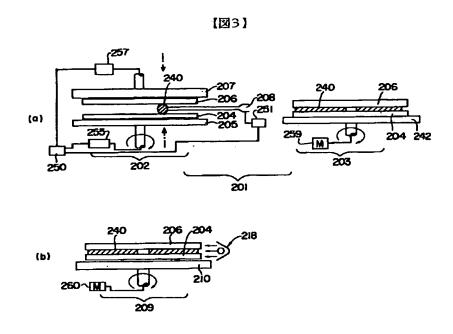


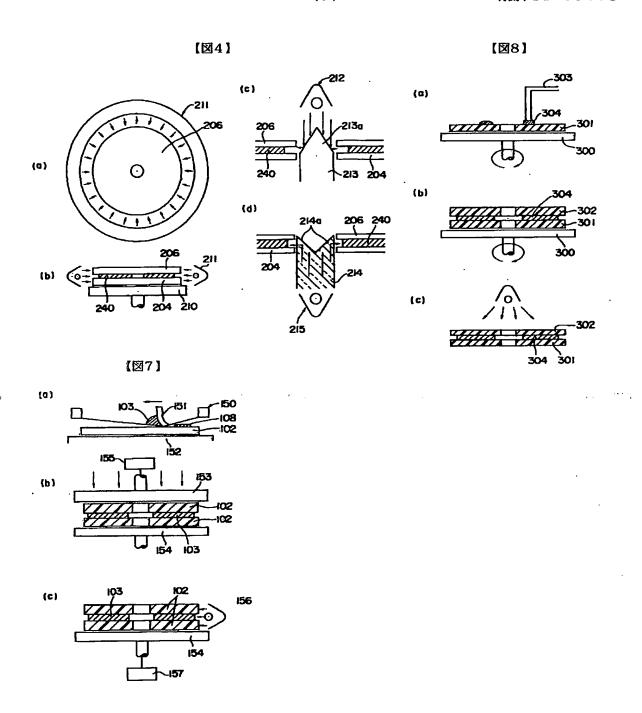
【図5】











フロントページの続き

(72)発明者 外園 信貴 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内